

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 25 年 10 月 10 日 (2013.10.10)

【公開番号】特開 2012-49471 (P2012-49471A)
 【公開日】平成 24 年 3 月 8 日 (2012.3.8)
 【年通号数】公開・登録公報 2012-010
 【出願番号】特願 2010-192701 (P2010-192701)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 21/027 (2006.01)

B 2 9 C 43/36 (2006.01)

B 2 9 C 59/02 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/30 5 0 2 D

B 2 9 C 43/36 Z N M

B 2 9 C 59/02 Z

【手続補正書】
 【提出日】平成 25 年 8 月 23 日 (2013.8.23)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0 0 0 6
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【0 0 0 6】

しかし、従来のインプリント装置では、インプリント処理で使用する樹脂の気化ガスやパターン欠陥を減少するためにパターン面周囲の空気と置換されるヘリウム等の気体がインプリント装置の外部に漏洩することがあった。本発明は、インプリント処理がなされる空間内の気体のインプリント装置外への流出とインプリント装置外のパーティクルの前記空間内への流入とを低減するのに有利なインプリント装置の提供を例示的目的とする。

【手続補正 2】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】0 0 0 8
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【0 0 0 8】

本発明によれば、例えば、インプリント処理がなされる空間内の気体のインプリント装置外への流出とインプリント装置外のパーティクルの前記空間内への流入とを低減するのに有利なインプリント装置を提供することができる。